

ポスター発表

12月10日 9:30-11:30

会場:横浜情報文化センター 6階ホール

Entry No	講演番号	講演者姓	講演者名	所属先	Paper Title(J)	Paper Title(E)
10013	Q-P10-001	北嶋	元樹	芝浦工業大学工学部応用化学科分離システム工学研究室	イオンビーム処理によるSOD膜の透過特性変化	Permeation improvements of SOD membranes by using ion beam
10048	Q-P10-002	辻	博司	京都大学工学研究科	ゲルマニウム負イオン注入による低速電子線励起発光材料の作製	Preparation of Luminescent Material For Low-Energy-Electron Excitation By Germanium Negative-Ion Implantation into Silica Glass
10460	Q-P10-003	草刈	将一	京都大学工学研究科原子核工学専攻	高速重イオンをプローブとした高級アルコールの低真空SIMS分析	Low Vacuum SIMS Measurement of Higher Alcohols with MeV-energy Heavy Ion Beam
10533	Q-P10-004	馬場	恒明	長崎県工業技術センター	プラズマソースイオン注入法とマグネトロンスパッタを併用した方法による金属添加DLC膜の作製と電気的特性	Preparation of Metal Containing Diamond-like Carbon Films by Plasma Source Ion Implantation with Magnetron Sputtering and Electrical Properties
10591	Q-P10-005	中尾	節男	産総研中部	スパッターPBIIIによるTiCN-DLCコンポジット膜の作成	Preparation of TiCN-DLC composite films by a combination of sputter and plasma based ion implantation technique
10598	Q-P10-006	瀬木	利夫	京都大学大学院原子核工学専攻	マルチノズルを用いたClF ₃ 中性クラスタービームによるSiエッチング	Si Etching with ClF ₃ Neutral Cluster Beam from Multi-nozzle
10629	Q-P10-007	鈴木	嘉昭	理化学研究所 生体反応制御材料研究チーム	イオンビーム照射したePTFEの血管吻合への応用	Ion Beam Irradiated ePTFE for Microsurgical Anastomosis
10674	Q-P10-008	竹内	光明	京都大学大学院工学研究科附属光・電子理工学教育研究センター	イオン液体EMIM-N(CN) ₂ イオンビームの表面照射効果	Effects of Ionic Liquid EMIM-N(CN) ₂ Ion Beam Irradiation
10675	Q-P10-009	竹内	光明	京都大学大学院工学研究科附属光・電子理工学教育研究センター	多原子分子イオン液体イオンビームの液体電気伝導度依存性	Polyatomic Ion Beam of Ionic Liquids with different conductivity
10696	Q-P10-010	麻野	敦資	日本原子力研究開発機構	機能性表面を有する一次元ナノ構造体の形成	Fabrication of 1-Dimensional Polymer Nanostructures with Functional Surfaces
10716	Q-P10-011	田中	俊行	独立行政法人 理化学研究所	イオンビーム照射したポリ乳酸ナノファイバー膜の生体適合性	Biocompatibility of ion-beam irradiated nanofibrous polylactide membranes
10720	Q-P10-012	鈴木	雅視	名古屋工業大学	イオンビームアシスト成膜によるc軸平行多層AlN薄膜の形成	c-axis parallel oriented multilayer AlN film grown by ion-beam assisted deposition

Entry No	講演番号	講演者姓	講演者名	所属先	Paper Title(J)	Paper Title(E)
10779	Q-P10-013	園田	勉	産業技術総合研究所	多元スパッタリングによるステンレス鋼基材へのMAX相含有Ti-Si-C薄膜の被覆	Coating of Stainless Steel Substrates with MAX-Phase-Containing Ti-Si-C Thin Films by Multi-Target Sputter-Deposition
10790	Q-P10-014	HATADA	Ruriko	Technische Universitaet Darmstadt, Germany		Investigation of the Suitability of a Grid-Like Sample Holder for Plasma Source Ion Implantation and Deposition